

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 3 部門第 3 区分
【発行日】 平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】 特表 2002-511894(P2002-511894A)

【公表日】 平成 14 年 4 月 16 日 (2002.4.16)

【出願番号】 特願 平 11-501434

【国際特許分類第 7 版】

C 0 8 K 5/3475

C 0 8 J 7/04

C 0 8 K 5/5435

C 0 8 L 83/04

C 0 9 D 183/04

【F I】

C 0 8 K 5/3475

C 0 8 J 7/04 Z

C 0 8 K 5/5435

C 0 8 L 83/04

C 0 9 D 183/04

【手続補正書】

【提出日】 平成 17 年 5 月 27 日 (2005.5.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】 補正の内容のとおり

【補正方法】 変更

【補正の内容】

手続補正書

平成17年 5月27日

特許庁長官殿



1. 事件の表示

平成11年特許願第501434号

2. 補正をする者

氏名(名称) バイエル・アクチエンゲゼルシャフト



3. 代理人

住所

〒540-0001
大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル
青山特許事務所
電話 06-6949-1261 FAX 06-6949-0361

氏名

弁理士 (6214) 青山 葆



4. 補正対象書類名 明細書および請求の範囲

5. 補正対象項目名 明細書および請求の範囲



6. 補正の内容

次の箇所を補正します。

I. 請求の範囲

別紙の通り。

II. 明細書

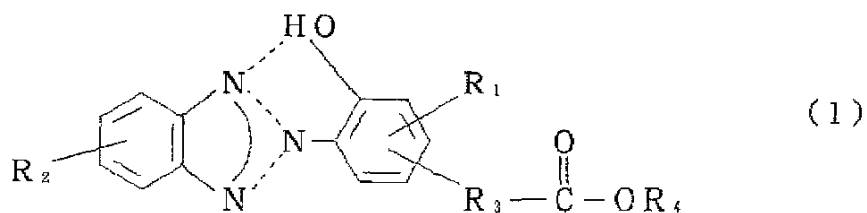
- (1) 第5頁第18行、「S i - O - S i - 結合まで」とあるを、「S i - O - S i - 結合を生じて」に訂正する。
- (2) 第6頁第12行、「耐引掻性被覆系およびシロキサンに基づく」とあるを、「シロキサンに基づく耐引掻性被覆系および」に訂正する。
- (3) 第7頁第6行、「分枝鎖中に」とあるを、「分子鎖中に」に訂正する。
- (4) 第7頁第15行、「アブライド」とあるを、「アライド」に訂正する。
- (5) 第10頁下から第4行、「350nmの波長にて」とあるを、「350nmの波長の」に訂正する。

以上

(別紙)

請求の範囲

1. (A) 一般式 (1)



〔式中、

R_1 : H、 $C_1 \sim C_{18}$ -アルキル、 $C_5 \sim C_6$ -シクロアルキルもしくは $C_6 \sim C_{12}$ -アリール、

R_2 : H、ハロゲン、好ましくはC1または $C_1 \sim C_{12}$ -アルキル、

R_3 : 単結合、 $C_1 \sim C_{12}$ -アルキレン、 $C_5 \sim C_6$ -シクロアルキレンまたはフェニレン、

R_4 : H、アルカリ金属、アンモニウム、アルカリ土類金属、 $C_1 \sim C_{12}$ -アルキル、 $-C(=O)-$ アルキル、 $C_6 \sim C_{12}$ -アリールまたは $-C(=O)-$ アリール

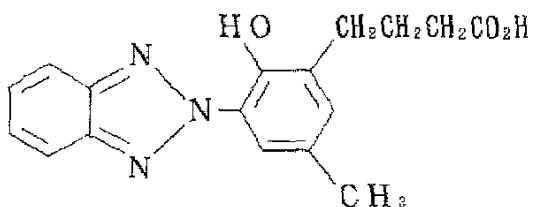
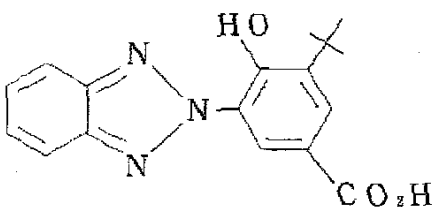
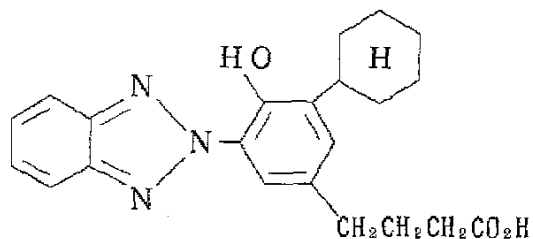
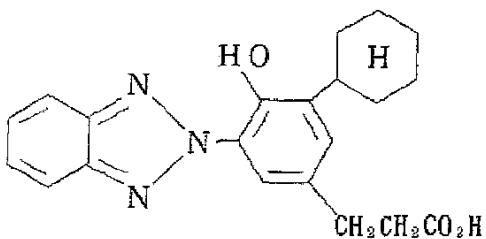
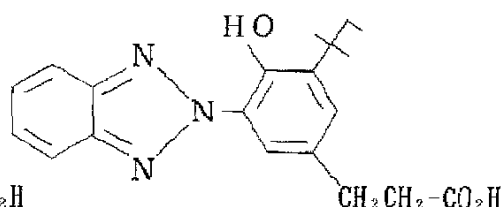
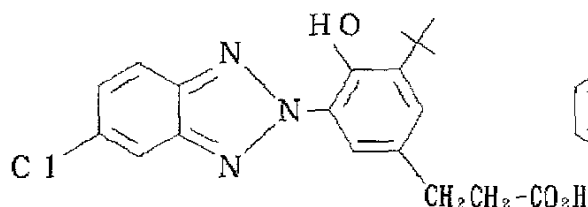
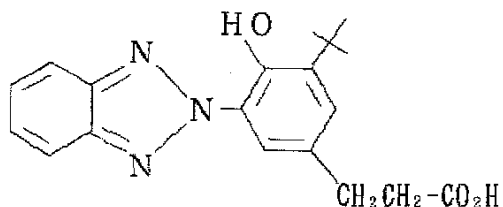
である〕

によるヒドロキシベンズトリアゾールと、

(B) エポキシド基を有する加水分解性シランと
を含有するUV-安定化剤混合物。

2. シランのエポキシド基と一般式 (1) のヒドロキシベンズトリアゾールとのモル比が1.4より大であることを特徴とする請求の範囲第1項に記載のUV-安定化剤混合物。

3. 一般式 (1) のヒドロキシベンズトリアゾールとして次のヒドロキシベンズトリアゾール：



の1種もしくはそれ以上が使用されることを特徴とする請求の範囲第1項または第2項に記載のUV-安定化剤混合物。

4. 一般式(1)のヒドロキシベンズトリアゾールと、エポキシド基を有する加水分解性シランとを混合し、少なくとも30分間にわたり少なくとも90℃まで加熱することを特徴とする請求の範囲第1～3項のいずれか一項に記載のUV-安定化剤混合物の製造方法。

5. 請求の範囲第1～3項のいずれか一項に記載のUV-安定化剤混合物を含有するシロキサン系。

6. 請求の範囲第4項の方法によって得られるUV-安定化剤混合物を含有する

シロキサン系。

7. ヒドロキシベンズトリアゾールの割合がシロキサン系の固形分に対し0.

3～20 重量%であることを特徴とする請求の範囲第5項または第6項に記載のシロキサン系。

8. 請求の範囲第5～7項のいずれか一項に記載のシロキサン系と、必要に応じ Si、Al、Sb および B 並びに遷移金属、好ましくは Ti、Ce、Fe および Zr の酸化物、酸化水和物、窒化物および炭化物から なる 群より選択される化合物からなる粒子状の物質とを含有し、この物質が 1～100 nm の範囲の粒子寸法を有することを特徴とするシロキサン系を含有するシロキサン被覆材料。

9. 任意の種類の支持体材料、好ましくは熱可塑性プラスチック、特に好ましくはポリカーボネートを被覆するための請求の範囲第8項に記載のシロキサン被覆材料の使用。

10. 少なくとも照射に露呈される材料の表面を請求の範囲第8項に記載のシロキサン被覆材料で被覆したことを特徴とする被覆した材料、好ましくはポリカーボネート。